Para publicación inmediata: 14/04/2015 **GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO**

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA PIONERA EN SU TIPO PARA CHIPS DE COMPUTADORA EN EL CAMPUS ALBANY NANOTECH DEL INSTITUTO POLITÉCNICO DE SUNY

Politécnico de SUNY y Nikon instalarán primera herramienta de litografía por inmersión de 450mm del mundo para acelerar la producción de la próxima generación de chips de computadora

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha iniciado la instalación del primer Escáner de Inmersión de 450mm del mundo en el Complejo Albany Nanotech del Instituto Politécnico de SUNY. Desarrollado por Nikon Corporation, esta herramienta pionera acelerará el desarrollo de la próxima generación de chips de computadora utilizados en una variedad de aplicaciones de consumo y comerciales.

“New York se enorgullece de ser el hogar de algunas de las investigaciones más sofisticadas en chips de computadora del planeta, y con miles de científicos e ingenieros desde Albany hasta Buffalo estamos haciendo crecer la industria como nunca antes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas inversiones estratégicas en nanotecnología, y replicar el éxito de Albany por todo el norte del estado, han atraído a líderes globales como Nikon que traen financiamiento privado y oportunidades de empleo a New York”.

Un equipo que incluye a más de 50 ingenieros de Estados Unidos y de todo el mundo estará involucrado en la instalación. La transición a 450mm encabezada por el Politécnico de SUNY es un salto tecnológico para la industria de los semiconductores. Con aplicaciones que incluyen teléfonos celulares, tabletas, defensa, energía verde, y muchos más, los 450mm producirán más del doble de la cantidad de chips procesados en las obleas actuales de 300mm, lo que llevará a menores costos y tecnologías mucho más rápidas y confiables para chips de computadora. Puede ver el escáner aquí.

New York es el primer estado en establecer esta tecnología de próxima generación en chips de computadora, que es el resultado del anuncio del Gobernador Cuomo en el 2011 de que socios de G450C, incluyendo a Intel, IBM, GLOBALFOUNDRIES, TSMC y Samsung invertirían más de $4.8 mil millones para construir el primer entorno para desarrollo de obleas y equipo de 450mm del mundo en el Complejo Nanotech del Politécnico de SUNY.

Toshikasu Umatate, vicepresidente senior y gerente general de la Unidad de Negocios de Litografía de Semiconductores de Nikon Corporation, dijo, “El programa 450mm de Nikon está avanzando constantemente, y este emocionante hito fue posible gracias a la estrecha colaboración con nuestros muchos socios de todo el consorcio. Nikon está comprometida a la constante innovación y avance en litografía, y a apoyar a la industria para llegar a la siguiente generación de manufactura de semiconductores”.

El Dr. Alain E. Kaloyeros, rector y director general del Instituto Politécnico de SUNY, dijo, “La entrega del Escáner de Inmersión de Nikon es una victoria para la innovación en el Estado de New York y otro importante hito en el mapa tecnológico del Gobernador Cuomo, llevando a la industria global de semiconductores al desarrollo de la siguiente generación de chips de computadora. El Estado de New York sigue a la vanguardia de la innovación, aprovechando los conocimientos y recursos de socios de clase mundial como Nikon mientras definimos el futuro de la tecnología de chips de computadora e impulsamos el desarrollo económico y la creación de empleos”.

En julio del 2013, el Gobernador Cuomo anunció una sociedad por $350 millones entre el Colegio de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala del Politécnico de SUNY y Nikon para desarrollar tecnología de fotolitografía de 450mm de siguiente generación. La fotolitografía se ha convertido en el paso crítico para permitir la manufactura de transistores medidos en nanómetros, que son los bloques de construcción de los chips de computadora de hoy. Nikon y el Politécnico de SUNY trabajaron incansablemente para echar a andar el escáner litográfico de inmersión en menos de 12 meses y develaron al mundo las primeras obleas de 450mm completamente estampadas en julio del 2014. La herramienta de inmersión de Nikon se suma a la infraestructura de 450mm existente en el Colegio de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala del Politécnico de SUNY, llevando la inversión total en equipo para obleas de 450mm en el Complejo Albany Nanotech a más de $700 millones.

Acerca de Nikon
Desde 1980, Nikon Corporation ha revolucionado la litografía con innovadores productos y tecnologías. La compañía es líder mundial en sistemas de litografía de semiconductores para la industria de manufactura de microelectrónica, con más de 8,000 sistemas de litografía (de semiconductores) instalados en todo el mundo. Nikon ofrece una amplia selección de sistemas de litografía de nivel de producción que sirven a las industrias de semiconductores, pantallas planas y cabezas magnéticas de película delgada. Nikon Precision Inc. proporciona servicios, capacitación, aplicaciones y soporte técnico, así como ventas y mercadotecnia para los sistemas de litografía de Nikon en Norteamérica. Para más información sobre Nikon, visite http://www.nikon.com.

###

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418